



一般社団法人光融合技術協会
“高速ホローカソード PECVD 装置導入にともなうの
技術説明会とデモンストレーションのご案内”

2019年10月22日 幹事 理事 小野明

益々ご盛栄のことと存じ、お喜び申し上げます。

このたび、当協会が管理運営しているフラウンホーファーFEP製高速パルススパッタ源 DRM400 搭載の縦型インラインスパッタ装置に、今世界的に注目されているドイツ、AGC-PTS 製**ホローカソードプラズマ PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) 装置**が導入されることになり、その立ち上げを11月25～27日に実施する予定です。これは、ホローカソードプラズマ源をPECVD用のプラズマとして用いたものであり、その特徴は、高速 (SiO₂ で動的成膜速度 >200nm. m/min でスパッタの数倍以上)、R2R やインライン向け幅広対応可能 (すでに 3.6m 幅用カソード実現)、構造上堆積物の剥離や落下が極めて少なく長時間安定、HMDSO 出発の SiO₂ でもカーボンフリー、極低内部応力、スパッタと同じ動作圧力なのでスパッタとの併用可能、などであり、プラスチックフィルムへのバリア膜や光学多層膜などの機能膜形成法として有望な技術です。そこで、当協会会員及び関係者の皆様にこれを有効活用していただくことを狙いに、その技術の紹介とデモンストレーションを11月28日に下記の要綱で開催することになりました。

また、同じくホローカソード放電を利用した超高速 arcPECVD を使ってバリア膜の検討を行っているフラウンホーファーFEPのDr. John Fahlteichが同時期来日することから、彼にも講演してもらえることになりました。

これら二つの技術の詳細とその応用可能性を知る絶好の機会と思いますので、是非ご参加ください。

日時 2019年11月28日 (10:30～18:00)

会場 宇都宮大学 オプティクス教育研究センター 1階会議室

宇都宮市陽東7-1-2 TEL : 028-689-7074

アクセス : <http://www.eng.utsunomiya-u.ac.jp/access/>(注意:陽東キャンパス)

陽東キャンパス⑧建屋 <https://www.utsunomiya-u.ac.jp/convenient/campus-map.php#yoto>

<プログラム>

- | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 10:30～11:00 | 受付 | |
| 11:00～11:30 | 開会、及び PECVD 装置導入の背景と PECVD 技術の概要紹介 | 協会理事 鈴木巧一 |
| 11:30～12:30 | AGC-PTS のホローカソード PECVD について | AGC-PTS Dr. Hugues Wiame |
| 12:30～13:30 | 昼食 | |
| 13:30～14:00 | 質疑応答 | |
| 14:00～15:00 | フラウンホーファーFEP の arcPECVD について : | Fraunhofer FEP Dr. John Fahlteich |
| 15:00～16:30 | ホローカソード PECVD 装置のデモンストレーション (放電と成膜実験) | |
| 16:45～18:00 | 交流会 | |

参加費

光融合技術協会会員 : 3,000円 (3人目からは非会員扱いとなります)

非会員 : 6,000円

資料代(後日PDF送付) : 会員無料、非会員 : 2000円

交流会 : 全員 3,000円

*お支払いは当日受付にて現金でお願いいたします。

参加申込書

ご参加ご希望の方は下記内容を E-mail で小野 akira.ono1257@gmail.com までお知らせください。

ご芳名

貴社名 種別 (会員 or 非会員)

ご所属 役職

交流会 参加 or 不参加

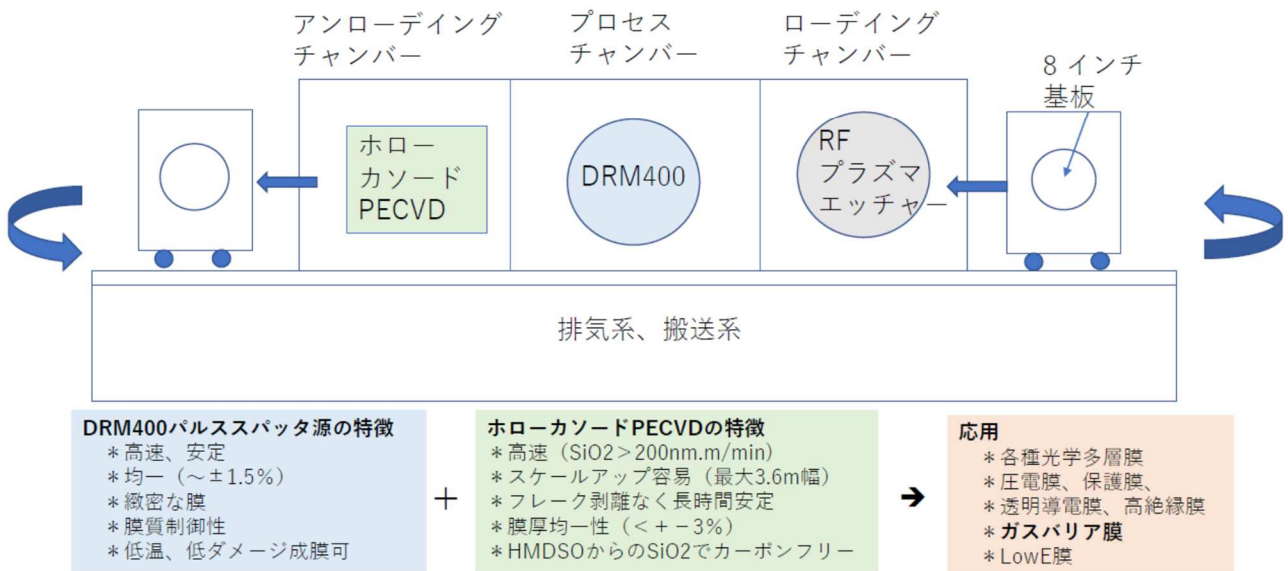
講演資料希望 有 or 無

所在地 〒

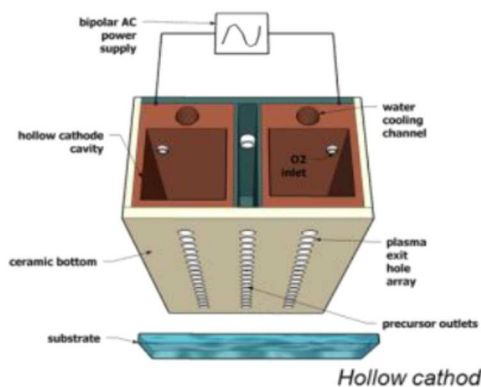
連絡先 Eメール & TEL

<参考>

縦型インラインパルスマグネトロンスパッタ装置 (宇都宮大学、地共センター設置)



AGC-PTS のホローカソード PECVD



原理



Lab 用



生産用 (3.6m 長)